

Title (en)

Process for the aftertreatment of layers from aluminium oxide with aqueous solutions containing phosphoroxo anions, and their use in the production of supports for offset printing plates.

Title (de)

Verfahren zur Nachbehandlung von Aluminiumoxidschichten mit Phosphoroxo-Anionen enthaltenden wässrigen Lösungen und deren Verwendung bei der Herstellung von Offsetdruckplattenträgern.

Title (fr)

Procédé de post-traitement de couches d'oxyde d'aluminium avec des solutions aqueuses contenant des phosphoroxo-anions et leur utilisation pour la fabrication de supports pour plaques d'impression offset.

Publication

EP 0161608 A1 19851121 (DE)

Application

EP 85105492 A 19850506

Priority

DE 3418111 A 19840516

Abstract (en)

[origin: US4650739A] A process for manufacturing materials in the form of sheets, foils or webs comprising chemically, mechanically and/or electrochemically roughened and anodically oxidized aluminum or one of its alloys, wherein the resultant aluminum oxide layers are post-treated with an aqueous solution containing phosphoroxo anions, is performed such that a post-treatment of the aluminum oxide layers is effected by immersion in an aqueous solution containing hexametaphosphate anion. In a preferred embodiment, the aqueous solution is adjusted to a pH of 1 to 5 by addition of an acid. The resulting materials, which have reduced adsorption properties, are preferably employed as support materials for offset printing plates.

Abstract (de)

Das Verfahren zur Herstellung von platten-, folien- oder bandförmigen Materialien auf der Basis von chemisch, mechanisch und/oder elektrochemisch aufgerauhtem und anodisch oxidiertem Aluminium oder einer seiner Legierungen, deren Aluminiumoxidschichten mit einer Phosphoroxo-Anionen enthaltenden wässrigen Lösung nachbehandelt werden, ist so gestaltet, daß die Nachbehandlung der Aluminiumoxidschicht durch Tauchen in einer wässrigen Lösung mit einem Gehalt an Hexametaphosphat-Anionen durchgeführt wird. In einer bevorzugten Ausführungsform wird diese Lösung mit einer Säure auf einen pH-Wert von 1 bis 5 eingestellt. Bevorzugte Verwendung finden diese Materialien mit reduziertem Adsorptionsverhalten als Trägermaterial für Offsetdruckplatten.

IPC 1-7

C25D 11/24; B41N 1/08; B41N 3/00; G03C 1/94

IPC 8 full level

B41N 3/00 (2006.01); **B41N 1/08** (2006.01); **B41N 3/03** (2006.01); **C25D 11/24** (2006.01)

CPC (source: EP US)

B41N 3/038 (2013.01 - EP US); **C25D 11/24** (2013.01 - EP US); **Y10S 205/921** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- EP 0086957 A1 19830831 - HOECHST AG [DE]
- DE 2609577 A1 19760909 - YOSHIDA KOGYO KK
- AT 316251 B 19740710 - HENKEL & CIE GMBH [DE]
- DE 1961182 A1 19700709 - ALUSUISSE
- PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, unexamined applications, C Field, No. 149, 10. August 1982, vol. 6 THE PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT Seite 107 C 118 * JP - A - 57-70 292 (TOUYOU KOUHAN K.K.) *

Cited by

EP1013469A1

Designated contracting state (EPC)

DE FR GB IT NL

DOCDB simple family (publication)

EP 0161608 A1 19851121; **EP 0161608 B1 19870812**; BR 8502292 A 19860121; CA 1271958 A 19900724; DE 3418111 A1 19851121; DE 3560465 D1 19870917; JP H0545437 B2 19930709; JP S60253597 A 19851214; US 4650739 A 19870317; ZA 853680 B 19851224

DOCDB simple family (application)

EP 85105492 A 19850506; BR 8502292 A 19850515; CA 481442 A 19850514; DE 3418111 A 19840516; DE 3560465 T 19850506; JP 10282585 A 19850516; US 73414785 A 19850515; ZA 853680 A 19850515